

高濃度オゾン水によるレジスト除去技術

レジスト除去

従来

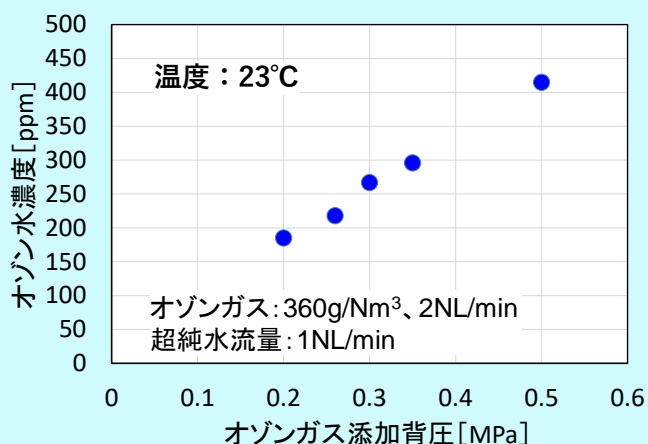
硫酸
+
過酸化水素
水溶液

環境負荷
が高い!!

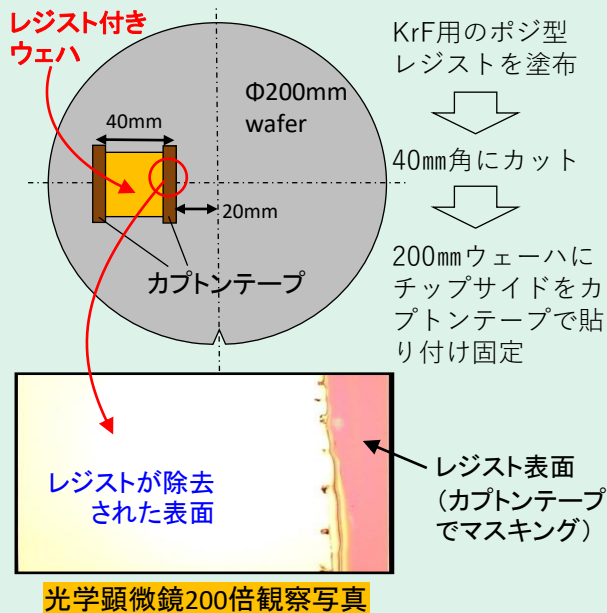
新技術

0.02% (200ppm) 程度の
温度制御した
高濃度オゾン水

加圧溶解法によるオゾン水濃度



60°C以上に昇温した後も
200ppm以上の高濃度オゾン水を実現



オゾン水作成条件 ※

溶解方式	加圧溶解1Pass
薬液流量	1.0 L/min
オゾン水濃度	415 ppm
供給水温度	23 °C
タンク内圧力	0.5 M Pa
供給オゾンガス濃度	360 g/m ³
オゾンガス流量	2 NL

レジスト剥離 処理条件	ノズル出口 オゾン水濃度 (KI法) [ppm]	結果	推定レジスト 剥離レート [nm/min]
23°C 70sec	415	全剥離	857

800nm/minを超える
レジスト除去性能を実現!!

この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業の結果得られたものです。